

## Si 含量对电弧离子镀Ti -Al -Si -N薄膜组织结构和力学性能的影响

时婧<sup>1)</sup>, 裴志亮<sup>1)</sup>, 宫骏<sup>1)</sup>, 孙超<sup>1)</sup>, MUDERS C M<sup>2)</sup>, 姜辛<sup>2)</sup>

1) 中国科学院金属研究所金属腐蚀与防护国家重点实验室, 沈阳 110016

2) Institute of Materials Engineering, University of Siegen, Paul-Bonatz-Strasse 9-11, Siegen 57076, Germany

### EFFECT OF SI CONTENT ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Ti-AL-SI-N FILMS DEPOSITED BY CATHODIC VACUUM ARC ION PLATING

SHI Jing<sup>1)</sup>, PEI Zhiliang<sup>1)</sup>, GONG Jun<sup>1)</sup>, SUN Chao<sup>1)</sup>, MUDERS C M<sup>2)</sup>, JIANG Xin<sup>2)</sup>

1) State Key Laboratory for Corrosion and Protection, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang

2) Institute of Materials Engineering, University of Siegen, Paul-Bonatz-Strasse 9-11, Siegen 57076, Germany

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(28\)](#)

[相关文章 \(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

美女图片

美女 美女美女 美女美女